

Procedeu de depunere a acoperirilor din electrolit pe bază de nichel, care include depunerea acoperirii de nichel dintr-un electrolit, care conține, g/l: $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – 320, $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ – 60, H_3BO_3 – 40, $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ – 0,5...2,5, $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ – 0,5, la o temperatură a electrolitului de 30...50°C și o densitate a curentului catodic de 0,2...0,8 kA/m², cu utilizarea unei surse de curent trifazat și a unui dispozitiv inductiv-capacitiv, conectat consecutiv în circuitul de alimentare a băii galvanice, totodată dispozitivul este format din două blocuri – capacitiv și inductiv, conectate paralel între ele, blocul inductiv având inductanța în limitele 0,1...10,0 H, iar blocul capacitiv având capacitatea sumară în limitele 0,001...0,11 F.